



## マスクレス露光装置

# マイクロライターML (micro lithography) family

1  $\mu\text{m}$ の分解能のマスクレス露光装置の中では最安級！



- マスクを使わない描画装置で少量のパターン試作が手早く可能！  
—— パターン作成時に毎回必要なマスク作成の手間を省きます
- 0.6 $\mu\text{m}$ 、0.4 $\mu\text{m}$ 分解能の上位機種へ現場でアップグレードも可能
- 貸出デモ実施中！  
—— お気軽にご連絡下さい

Durham Magneto Optics Ltd社ホームページ  
<https://www.durhammagnetooptics.com/>  
世界市場で100台以上実績あり



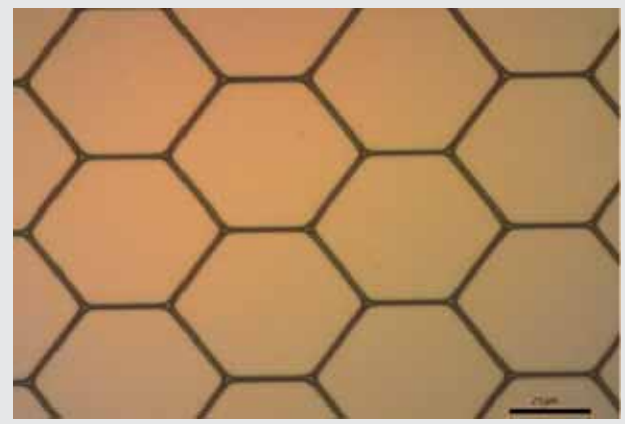
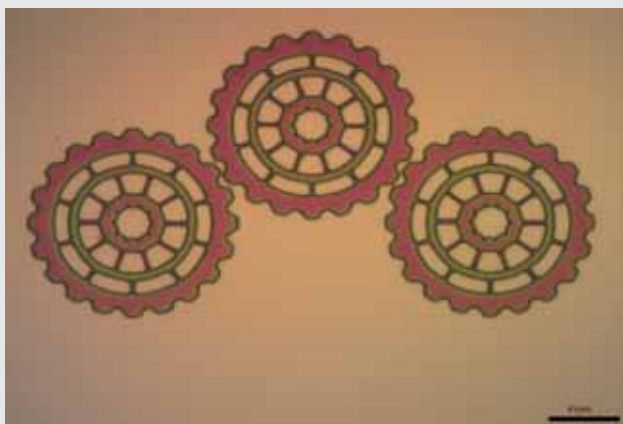
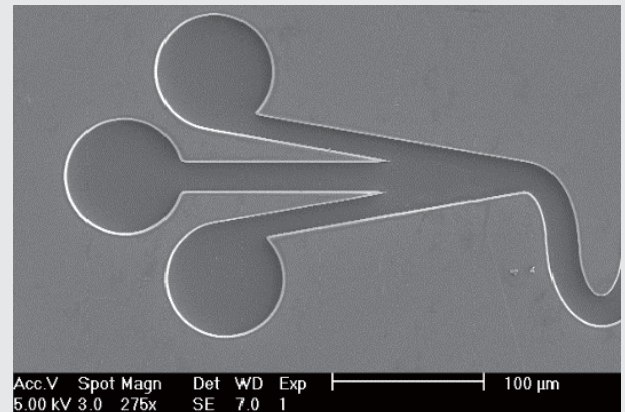
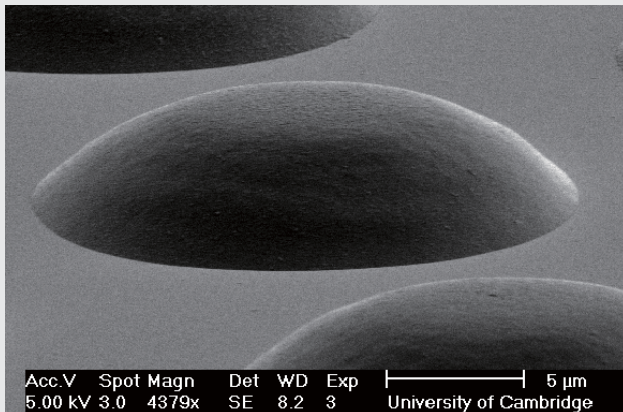


## 仕様表

	ML3 Baby	ML3 Baby plus	ML3 Mesa	ML3 Pro
描画分解能	1 $\mu\text{m}$	1 $\mu\text{m}$ , 5 $\mu\text{m}$	0.6 $\mu\text{m}$ , 1 $\mu\text{m}$ , 5 $\mu\text{m}$	0.6 $\mu\text{m}$ , 1 $\mu\text{m}$ , 2 $\mu\text{m}$ , 5 $\mu\text{m}$ (0.4 $\mu\text{m}$ OPT)
描画範囲	149×149 mm	149×149 mm	149×149 mm	195×195 mm
最大ウエハーサイズ	155×155×7 mm	155×155×7 mm	155×155×7 mm	230×230×15 mm
対物レンズ	×10 (×4デジタルズーム)	×3, ×10 (×4デジタルズーム)	×3, ×5, ×10 (×4デジタルズーム)	×3, ×5, ×10, ×20, (×50 OPT) (×4デジタルズーム)
描画波長	405 nm(385, 365 nm, OPT)	405 nm(385, 365 nm, OPT)	405 nm(385, 365 nm, OPT)	385 nm(365 nm OPT)
描画速度	50 mm <sup>2</sup> /分@1 $\mu\text{m}$ 分解能	50 mm <sup>2</sup> /分@1 $\mu\text{m}$ 分解能 180 mm <sup>2</sup> /分@5 $\mu\text{m}$ 分解能	17 mm <sup>2</sup> /分@0.6 $\mu\text{m}$ 分解能 50 mm <sup>2</sup> /分@1 $\mu\text{m}$ 分解能 180 mm <sup>2</sup> /分@5 $\mu\text{m}$ 分解能	17 mm <sup>2</sup> /分@0.6 $\mu\text{m}$ 分解能 50 mm <sup>2</sup> /分@1 $\mu\text{m}$ 分解能 120 mm <sup>2</sup> /分@2 $\mu\text{m}$ 分解能 180 mm <sup>2</sup> /分@5 $\mu\text{m}$ 分解能
モーションステージ最小ステップ(X,Y)	15 nm	15 nm	15 nm	4 nm
光学表面プロファイラー分解能(Z方向)	無	200 nm	200 nm	100 nm
重ね合わせ精度	±2 $\mu\text{m}$ (3 $\sigma$ )	±1 $\mu\text{m}$ (3 $\sigma$ )	±1 $\mu\text{m}$ (3 $\sigma$ )	±0.5 $\mu\text{m}$ (3 $\sigma$ )
受け入れ可能ファイルフォーマット	CIF, GDS2, BMP, TIFF, JPEG, PNG, GIF			

## 測定例

### グレースケール(3D)描画機能標準搭載



(Courtesy of the Francis Crick Institute's Making Lab, London)

